智慧財產及商業法院民事判決

111年度民專上字第2號

上　訴　人　凌嘉科技股份有限公司

法定代理人　陳連春
訴訟代理人　陳冠宏律師
　　蔣昕佑律師
複 代理 人　陳豫宛

訴訟代理人　唐嘉瑜律師
　　張晁綱律師
被 上訴 人　友威科技股份有限公司

法定代理人　李原吉
訴訟代理人　楊理安律師
　　趙嘉文

　　吳俊億
　　胡峰賓律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國110年10月19日本院109年度民專訴字第85號第一審判決提起上訴，本院於111年6月23日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、上訴人於原審主張被上訴人所製造銷售之「水平連續式濺鍍系統」（產品型號：ＯＯＯ，下稱系爭產品1），及ＯＯＯ型號產品（下稱系爭產品2，與系爭產品1合稱系爭產品）侵害其中華民國發明第TWI513840號「多層膜的量產方法」專

利（下稱系爭專利），依專利法第96條第1至3項、第97條及民法第184條第1項前段、第2項、第179條規定，請求命被上訴人排除、預防侵害，及給付上訴人新臺幣（下同）500萬元本息。嗣於本院審理中，主張被上訴人製造、銷售系爭產品供訴外人ＯＯＯ公司（下稱ＯＯＯ公司），實施系爭專利，依民法第185條規定與ＯＯＯ公司為共同侵權行為人，乃究其於原審主張被上訴人侵害其專利權補充事實上級法律上陳述，依民事訴訟法第256條規定，非為訴之變更、追加。

二、按當事人於第二審不得提出新攻擊或防禦方法，但對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者，不在此限，民事訴訟法第447條第1項第3款定有明文。被上訴人雖抗辯上訴人遲至第二審才提出民國110年5月10日拍攝之上證1照片，該證物並無不能於原審及時提出之情形，應屬新防禦方法而不得提出云云。然上訴人提出上證1，無非係就於原審主張被上訴人製造生產系爭產品侵害上訴人系爭專利權所為防禦方法之補充，揆諸上開規定，均應予准許。

貳、實體方面：

一、上訴人主張：上訴人為系爭專利權人，專利權期間自103年12月25日至123年12月24日止。兩造均為104年ＯＯＯ公司真空濺鍍設備之競標廠商。被上訴人未經上訴人授權同意所製造銷售系爭產品之方法，落入系爭專利請求項1至10之文義或均等範圍。被上訴人之行為侵害上訴人之系爭專利權，並受有未支出授權金及銷售系爭產品所得之不當得利。被上訴人製造銷售系爭產品1予ＯＯＯ公司實施系爭專利權，為共同侵權行為人。爰依專利法第96條第1至3項及民法第184條第1項前段、第2項、第179條及第185條規定，求為命被上訴人給付上訴人500萬元本息，及命被上訴人排除、防止侵害之判決。原審為上訴人敗訴之判決，上訴人不服提起上訴。並聲明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人不得直接或間接、自行或使他人使用系爭專利、使用或設計或製造使用系爭專利方

法之設備或物、亦不得使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口系爭專利方法製成之物。㈢被上訴人應回收並銷毀侵害系爭專利方法之物及從事侵害行為之設備及物。㈣被上訴人應給付上訴人500萬元整，暨自原審起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈤前三項聲明，如獲有利判決，上訴人願供擔保，請准宣告假執行。

二、被上訴人則以：上訴人未證明系爭產品落入系爭專利權範圍，亦無證據證明被上訴人自行或與他人共同在我國境內實施系爭專利。被上訴人於系爭專利申請日前即已實施專利，或至少已完成實施系爭專利之必須準備工作，符合專利法第59條第1項第3款本文規定而為系爭專利之效力所不及。附件所示證據組合足以證明系爭專利不具進步性等語，資為抗辯。並聲明：㈠上訴駁回。㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

三、本院之判斷：

上訴人主張系爭產品落入系爭專利請求項1至10之文義或均等範圍，惟為被上訴人所否認，並以前詞置辯，是本件爭點在於：㈠系爭產品1是否落入系爭專利請求項1至10之文義或均等範圍？㈡系爭產品2是否落入系爭專利請求項1至10之文義或均等範圍？㈢被上訴人得否依專利法第59條第1項第3款規定，主張先實施之抗辯？㈣被上訴人得否依專利法第59條第1項第2款規定，主張因研究或實驗為目的之行為，不受專利權效力所及？㈤系爭專利是否有應撤銷之事由？就上開爭點，本院認系爭產品未落入系爭專利請求項1至10之文義或均等範圍，其餘爭點已毋庸審酌，茲析述如下。

㈠系爭專利技術內容（如附圖所示）：

1.習知多層膜的量產方法雖然能夠量產出整批次之多層膜的完成品，但在量產過程中，爲均勻地鍍製出該等多層膜，該等待鍍物於各鍍膜區間執行各鍍膜製程時需分別於各鍍膜區間的靶材下方位移多次。然而，由於各鍍膜區間之靶材下方位置處是屬於一電漿區，因此，在進行各厚度達數十奈

米至數十微米之多層膜的鍍膜製程中，該等待鍍物將因長時間暴露在各電漿區而衍生出過熱問題。一旦該等待鍍物是由不耐熱的材質所構成時，該等待鍍物也將因前述過熱問題而產生變形，以致於降低該等完成品的鍍膜品質。再者，上述鍍膜生產線也礙於該量產設備的限制，該載具只能令該整批待鍍物中的單一個待鍍物在完成每一鍍膜區間的鍍膜製程以產生其完成品後，才能再重新載放下一個待鍍物。因此，導致未執行鍍膜製程的鍍膜區間閒置，並造成量產效率不彰且提高時間成本的困擾。經上述說明可知，在解決待鍍物過熱等問題的前提下，找出如何更有效率地利用每一鍍膜區間以提升量產效率，是此技術領域的相關技術人員所待突破的難題。因此，本發明之目的，即在提供一種多層膜的量產方法。本發明之功效在於：利用該鍍膜生產線之依序輪流配置的緩衝區間與鍍膜區間，並配合該等載具同時進入相對應的各鍍膜區間內執行各道鍍膜程序時，是於各鍍膜區間之兩相鄰緩衝區間位移，使各鍍膜區間內是同時執行各道鍍膜程序且未呈現出閒置狀態，以有效地利用各鍍膜區間並提高鍍膜生產線的利用率，進而提高產能(見原審卷一第49至52頁）。

2.系爭專利為多層膜的量產方法，是令多數待鍍物進行多道鍍膜程序並依序包含(a)提供具(n+1)個緩衝區間、n個鍍膜區間及多個載具的鍍膜生產線，緩衝區間與鍍膜區間沿一排列方向輪流設於一真空腔體內；(b)於第一個緩衝區間載入置有第一個待鍍物的第一個載具；(c)令第一個載具於第一個鍍膜區間執行第一道鍍膜程序時是於第一、二個緩衝區間位移數次；(d)令第一個載具位於第二個緩衝區間且同時於第一個緩衝區間載入置有第二個待鍍物的第二個載具；及(e)同時令第二與第一個載具於第一與第二個鍍膜區間執行第一與第二道鍍膜程序時是各於第一、二個與第二、三個緩衝區間位移數次（見原審卷一第45頁）。

㈡系爭產品技術內容：

系爭產品1為置於第三人ＯＯＯ公司之ＯＯＯ「水平連續式濺鍍系統」，系爭產品2為型號「ＯＯＯ」產品，上訴人用以證明系爭產品1、2侵害系爭專利之相關資料(包含本院保全證據所得資料)受秘密保持命令保護，內容詳卷。

㈢系爭產品1未落入系爭專利請求項1至10之專利權範圍：

1.請求項1部分：

⑴系爭專利請求項1與系爭產品1，可對應拆解為附表一所示7個要件。

⑵文義比對：

①就要件編號1F、1G部分，由上訴人所指之原證3第15頁設備圖、第16頁濺鍍流程圖、ＯＯＯ產品保養手冊第12頁第3張圖、操作手冊第12頁、保全證據IMG_00000000_161819照片(見原審卷一第100至101頁、本院限閱卷第81頁、原審限閱卷一第108、204頁)，至多僅能證明系爭產品1之濺鍍腔與緩衝腔可容納複數載盤，並不足以證明當第一個載具位於第二個緩衝腔CHB33或第三個緩衝腔CHB35時，第二個載具係「同時」位於該鍍膜生產線的第一個緩衝腔CHB31或第二個緩衝腔CHB33，亦不足以證明系爭產品1之鍍膜程序係「同時」令第二個載具與第一個載具分別於第一個鍍膜腔CHB32與第二個鍍膜腔CHB34內執行鍍膜程序，且第二個載具與第一個載具同時分別於第一、二個緩衝區間兩者間與第二、三個緩衝區間兩者間位移至少一次。是系爭產品1無法為系爭專利請求項1要件編號1F、1G文義讀取。

②上訴人雖主張：ＯＯＯ產品保養手冊第12頁第3張圖可見，系爭產品1之第一個鍍膜腔CHB32與第二個鍍膜腔CHB34均放置有黃色載盤而可同時執行鍍膜程序；且原證8之ＯＯＯ產品規格書第1頁明確揭示該產品為水平連續式濺鍍系統，該規格書第7頁第2點系統規格之2.1真空腔體模組，也明載其僅有一個出料腔體，故當系爭產品1於其載盤為滿載的情況下（即ＯＯＯ產品保養手冊第12頁第3張圖所示），則於執行連續式濺鍍作業且又僅有一個出料腔體之情況下，各腔室

之載盤必然同時且分別於第一、二個緩衝區間兩者間與第二、三個緩衝區間兩者間位移至少一次，且各載盤不可能同時位於同一緩衝區，故系爭產品1之技術內容應已被系爭專利請求項1之技術特徵要件1F、1G文義讀取云云，惟查：

❶ＯＯＯ產品保養手冊第12頁第3張圖係於系統停機執行「靶材更換」之作業流程(參產品保養手冊第12頁標題5.靶材更換)，該圖左上角明示「自動作業停止」，顯見並非進行鍍膜程序時之操作流程；原證8之操作手冊第12頁設備傳輸控制及保全證據IMG_00000000_161819照片左上揭示「自動作業停止」，且未顯示任何載入待鍍物載盤之(黃色)標記，亦無法說明第1、2個載具與緩衝區間之關係；原證3第15頁僅揭示第一載具位於真空腔體CHB22，第二載具位於載入區域Load Area，而在第一載具前進至第二緩衝腔CHB33或第三緩衝腔CHB35時，仍無法確定第二載具「同時」位於第一緩衝腔CHB31或第二緩衝腔CHB33，例如當第一載具第二緩衝腔CHB33時，第二載具可能位於CHB1、CHB21、CHB22、CHB31、CHB32或仍在Load Area，並無法得知第二載具係如要件1F所界定位於第一緩衝腔CHB31，且該操作手冊第12頁設備傳輸控制雖包含「內部傳輸控制：可對各CHB傳輸進行正轉、反轉、定位(HOME)與鍍膜室工作速度的運轉…」然至多僅能說明系爭產品1可對各腔室之傳輸部件進行正轉、反轉、定位與工作速度等控制動作，與系爭專利要件編號1F無必然關係，以上自無法證明系爭產品1之技術內容能被要件1F文義讀取。

❷再者，上開證據至多只能證明系爭產品1具有三個濺鍍腔CHB32、CHB34、CHB36，載具可進行多道濺鍍製程，然而並無法得知第二個載具在第一個鍍膜區間執行第一道鍍膜程序時，第一個載具同時位於第二個鍍膜區間執行第二道鍍膜程序，或同時分別於第一、二個緩衝腔兩者間與第二、三個緩衝腔兩者間位移至少一次，亦無法得知當第二個載具位於第二緩衝腔CHB33時，第一個載具是位於第三緩衝腔CHB35，因該第

二個載具可能仍位於第二濺鍍腔CHB34或已前進至第三濺鍍腔CHB36；同理，原證8之操作手冊第12頁設備傳輸控制所載內容至多僅能說明系爭產品1可對各腔室之傳輸部件進行正轉、反轉、定位與工作速度等控制動作，不必然可推論系爭專利要件編號1G之載具和緩衝區間關係，因此，亦難認定系爭產品1能被系爭專利請求項1要件編號1G文義讀取。

❸此外，若系爭產品1之該等載具係以上訴人所稱之滿載方式設置於各腔室內(參ＯＯＯ產品保養手冊第12頁第3張圖)，則熟習該項技術者當可推知系爭產品1之第二個載具位於第二個緩衝區間時，其第一個載具應會位於第二濺鍍腔而非第三個緩衝區間，故亦難謂系爭產品1之技術內容能符合「但有條件的是，當第二個載具位於第二個緩衝區間時，第一個載具是位於第三個緩衝區間」之限定條件，遑論能被系爭專利請求項1要件編號1F或1G文義讀取。

③因此，上訴人無法證明系爭產品1之操作程序為系爭專利請求項1要件編號1F、1G文義讀取，系爭產品1未落入系爭專利請求項1之文義範圍，以下續為均等論之分析。

⑶均等比對：

上訴人主張：縱認上開證據無法確認進行濺鍍程序時之真實狀態，然原證8之產品規格書第1頁已經明確揭示系爭產品1為連續式濺鍍系統、原證8第6頁顯示每盤可放置6個載盤，且原證8第7頁顯示其具有4個緩衝腔，並有18組載盤數，因此，系爭產品1其實質上仍係以相同的方式（將各載具置於各緩衝區間）執行相同的功能（緩衝功能），並達成實質相同的結果（冷卻並等待進入下一鍍膜區），故系爭產品1之技術內容與系爭專利請求項1之技術特徵要件1F、1G構成均等論，應認系爭產品1落入該請求項之均等範圍等云云。惟查：

①依系爭專利說明書【先前技術】［0003]~[0004］記載「在製模程序中…該載具只能…在完成每一鍍膜區間的鍍膜製程以產生其完成品後，才能重新載放下一個待鍍物…造成量產

效率不彰且提高時間成本的困擾」、【發明內容】［0013］記載「本發明之功效在於…有效地利用各鍍膜區間並提高鍍膜生產線的利用率，進而提高產能」、【實施方式】記載（見原審卷一第49至50、51至62頁）可知，系爭專利之發明技術特徵要件1F、1G藉由採用具有「但有條件的是，當第二個載具位於第二個緩衝區間時，第一個載具是位於第三個緩衝區間」限定條件之技術手段，發揮前後二載具之待鍍物可同時進行濺鍍程序(即無須待前一待鍍物完成其濺鍍程序後，才能進行後一待鍍物的濺鍍程序)或緩衝之功能，以達成其所稱降低時間成本結果，並據此以與先前技術習知者進行區隔。

②將前述證據所示者之技術內容與系爭專利請求項1技術特徵要件1F、1G比對後可知，就技術手段而言，上訴人所提前述證據所示者之第二個載具位於第二個緩衝區間時，其第一個載具係位於第三濺鍍腔，至少已與系爭專利該請求項所界定須包含「但有條件的是，當第二個載具位於第二個緩衝區間時，第一個載具是位於第三個緩衝區間」限制條件之技術手段，不構成相同或實質相同。就功能而言，由於該等證據所示者應無法發揮系爭專利之前後二載具之待鍍物可同時進行濺鍍程序或緩衝的功能，不構成相同或實質相同。就結果而言，由於該等證據所示者之操作方式與系爭專利請求項1該等要件所須限定條件明顯不同，應無法達成相同或實質相同程度之時間成本的降低，故其等之結果亦不構成相同或實質相同。準此，系爭產品1之技術內容與系爭專利請求項1技術特徵要件1F、1G之功能、技術手段及結果不構成相同或實質相同，是系爭產品1未為系爭專利請求項1要件1F、1G所均等。因此，系爭產品1未落入系爭專利請求項1之均等範圍。

⑷據上，系爭產品1未落入系爭專利請求項1之專利權範圍。

2.請求項2至10部分：

系爭專利請求項2至10係直接或間接依附於請求項1，為請求項1權利範圍之進一步限縮；而如前述，系爭產品1既未落入

系爭專利請求項1之專利權範圍，因此，系爭產品1當然亦未落入系爭專利請求項2至10之專利權範圍。

㈣系爭產品2未落入系爭專利請求項1至10之專利權範圍：

1.上訴人雖提出原證9型號「ＯＯＯ」水平連續式濺鍍系統規格書、原證10之友威公司簡報資料、原證11之影片截圖畫面及光碟、原證12之操作畫面截圖、原證20之光碟、上證1之機台控制畫面截圖(見原審秘保限閱卷一第275至341頁、第483頁、本院卷一第151頁），用以證明系爭產品2(ＯＯＯ)係使用系爭專利之方法而落入系爭專利請求項1文義及均等範圍。查原證9、10固可證明被上訴人有製造型號「ＯＯＯ」產品，然原證11、12、20所顯示之機台控制介面，右上角僅有被上訴人商標「UVAT」，並無機台型號可判斷其即為「ＯＯＯ」，又上證1機台控制畫面雖顯示友威科技、ＯＯＯ字樣，但也只能證明被上訴人有製造型號「ＯＯＯ」產品，無法證明該產品之操作介面如原證11、12、20所示，另原證11、12、20與上證1顯示日期分別為2021年5月15日、5月10日、5月20日與5月10日，無法認定是針對同一機台在同一操作程序下拍攝之資料，且原證11、原證20影片畫面左上角顯示「異常發生」、原證12照片左上角顯示「自動作業停止」，顯見拍攝當下該機台並非處於正常運作狀態，因此，原證11、12、20無法用以證明是系爭產品2運作時之狀態。又縱使上開證據可認為是系爭產品2之操作方式，然仍無法認定系爭產品2落入系爭專利請求項1至10之專利權範圍，茲分述如下。

2.請求項1部分：

⑴系爭專利請求項1與系爭產品2，可對應拆解為附表二所示7個要件。

⑵文義比對：

就要件編號1G部分，由上訴人所指原證9第5頁、原證10第8頁（見原審限閱卷一第279、296頁）之內容，僅能證明系爭產品2之5個載盤可於濺鍍沉積區中來回往復移動，並不足以

證明第二個載具與第一個載具分別於第一個鍍膜區間與第二個鍍膜區間內「同時」執行第一道鍍膜程序與第二道鍍膜程序、且「同時」分別於第一、二個緩衝區間兩者間與第二、三個緩衝區間兩者間位移至少一次，亦不能證明當第二個載具位於第二個緩衝區間時，第一個載具是位於第三個緩衝區間之條件。又經本院當庭勘驗原證11影片，其第二個黃色載盤位於第二個緩衝腔CHB33時，第一個黃色載盤是位於第四個緩衝腔CHB37，當庭勘驗原證20影片，其第二個黃色載盤位於第二個緩衝腔CHB33時，第一個黃色載盤位於第二個濺鍍腔CHB34(均見本院卷二第125頁勘驗筆錄)，由上可知，原證11、20之第二個載盤位於第二個緩衝腔時，第一個載盤或位於第四個緩衝腔，或位於第二個濺鍍腔，均非位於第三緩衝腔CHB35，自與系爭專利請求項1要件編號1G所定「但有條件的是，當第二個載具位於第二個緩衝區間時，第一個載具是位於第三個緩衝區間」文義不符。上訴人無法證明系爭產品2之操作程序為系爭專利請求項1要件編號1G文義讀取，系爭產品2未落入系爭專利請求項1之文義範圍，以下續為均等論之分析。

⑶均等比對：

上訴人雖主張：原證11、20是因為產品未連續載入載盤，才會有間相隔有未載入載盤之閒置腔室，然仍應認系爭產品2實質上係以相同的方式（將各載具由緩衝區間進入下一個鍍膜區間執行鍍膜程序）執行相同的功能（連續的鍍膜功能），並達成實質相同的結果(得到多個待鍍物同時完成鍍膜），自落入系爭專利請求項1要件編號1G之均等範圍云云。惟查：

①由系爭專利說明書【先前技術】[0003]~[0004]、【發明內容】[0013]、【實施方式】之記載可知，系爭專利之發明該技術特徵要件1G主要係採同時利用鍍膜生產線之各鍍膜區間進行鍍膜程序之手段，發揮充分運用各濺鍍區之功能，以達

成沒有鍍膜區間被閒置之(最重要)結果，並據此以與先前技術習知者進行區隔。

②就技術手段而言，該等影片所示者之濺鍍腔並未完全被使用，與系爭專利請求項1須同時利用鍍膜生產線之各鍍膜區間進行鍍膜程序之技術手段，不構成相同或實質相同。就功能而言，由於該等影片所示者之濺鍍腔並未完全被使用，尚難發揮系爭專利之充分運用各濺鍍區的功能，不構成相同或實質相同。就結果而言，由於該等影片所示者之複數濺鍍腔中，至少有一個是被閒置而未使用的，與系爭專利請求項1所欲達成沒有鍍膜區間被閒置之結果，不構成相同或實質相同。準此，系爭產品2之技術內容與系爭專利請求項1技術特徵要件1G之功能、技術手段及結果不構成相同或實質相同，是系爭產品2未為系爭專利請求項1要件1G所均等。因此，系爭產品2未落入系爭專利請求項1之均等範圍。

⑷據上，系爭產品2未落入系爭專利請求項1之專利權範圍。

3.請求項2至10部分：

系爭專利請求項2至10係直接或間接依附於請求項1，為請求項1權利範圍之進一步限縮；而如前述，系爭產品2既未落入系爭專利請求項1之專利權範圍，因此，系爭產品2當然亦未落入系爭專利請求項2至10之專利權範圍。

四、綜上所述，系爭產品未落入系爭專利請求項1至10之文義或均等範圍，故系爭產品不構成侵害系爭專利權。從而，上訴人依專利法第96條第1至3項及民法第184條第1項前段、第2項、第179條及第185條規定，請求被上訴人不得直接或間接、自行或使他人使用系爭專利、使用或設計或製造使用系爭專利方法之設備或物、亦不得使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口系爭專利方法製成之物，及被上訴人應回收並銷毀侵害系爭專利方法之物及從事侵害行為之設備及物，及被上訴人應給付上訴人500萬元整，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，為無理

由，不應准許。從而原審為上訴人敗訴之判決，核無不合，上訴論旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由。

五、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。又上訴人雖聲請本院至ＯＯＯ公司ＯＯＯ廠勘驗系爭產品1實際執行鍍膜作業過程，及聲請發函命ＯＯＯ公司提出作業履歷檔及機台控制介面錄影影片（見本院卷一第145頁，限閱卷第30頁），並稱本件有證據偏在情形，若法院駁回其聲請將嚴重影響專利權人權利云云。然本院於本案訴訟繫屬前，已於109年6月23日依109年度民專抗字第8號保全證據裁定至ＯＯＯ公司ＯＯＯ廠就系爭產品1進行證據保全，並保全得到系爭產品1之拍攝照片檔、錄影檔，及系爭產品1之規格書、合約書、說明書、使用手冊、圖面、型錄、規劃建議書、報價單，而上訴人訴訟代理人陳冠宏律師於保全證據施行期日親自到現場執行時，對當時系爭產品1之運作狀況並無意見，亦未要求開啟機器了解其鍍膜作業過程（見本院109年度民專抗字第8號卷第162、189至191頁），此外，於本件審理中，原審法院亦於110年3月23日、同年7月27日二度依上訴人聲請發函向ＯＯＯ調取操作手冊、電路圖、系爭產品1所儲存之記錄履歷與操作紀錄、進行連續鍍膜量產作業時機台控制介面錄影影片等資料(見原審卷二第295、427頁)，以上，堪認本院於證據偏在之情況下已充分保障上訴人之訴訟權。而上訴人於民事訴訟中除有舉證義務外，亦有促進訴訟之義務，不能因上訴人向法院聲請證據保全或調查證據，所得結果無法證明其所主張之待證事實，即謂法院應准許上訴人為重複調查證據。上訴人上開聲請為重複調查，依前開說明，自不應准許。

六、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　6　　月　　30　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　李維心

法　官　陳端宜

法　官　蔡如琪

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項(詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　7　　月　　11　　日

書記官　黃奎彰

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。